

特別管理産業廃棄物排出源別一覧表（汚泥、廃酸、廃アルカリ）

排 出 源		物 質 名																										
業 種	施 設	アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機燐 <sup>リン</sup>	Cr (Ⅵ)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN	
19. 紡績業又は繊維製品製造業若しくは加工業	ト 染色施設						○				○	○				○	○	○	○									
	チ 薬液浸透施設										○	○				○	○	○	○									
	リ のり抜き施設										○	○				○	○	○	○									
21. 化学繊維製造業	イ 湿式紡糸施設												○															
	ロ リンター又は未精錬繊維の薬液処理施設												○												○		○	
	ハ 原料回収施設												○															
22. 木材薬品処理業	ロ 薬液浸透施設						○	○																				
23. パルプ、紙、紙加工品の製造業	イ 原料浸せき施設									○																		
	ニ 蒸解施設									○																		
	ホ 蒸解廃液濃縮施設									○																		
	ヘ チップ及びパルプ洗浄施設									○																		
	ト 漂白施設									○																		
	チ 抄紙施設									○																		
	リ セロハン製膜施設									○															○			
ヌ 湿式繊維板成型施設									○																			
ル 廃ガス洗浄施設									○																○			
23の2. 新聞業、出版業、印刷業又は製版業	現像洗浄施設等										○	○	○			○	○	○										
24. 化学肥料製造業	イ ろ過施設							○																				
	ロ 分離施設							○																				
	ハ 水洗式破碎施設							○																				
	ニ 廃ガス洗浄施設							○																				
ホ 湿式集じん施設							○																					
25. 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリ製造業	イ 塩水精製施設	○	○																									
	ロ 電解施設	○	○																									
26. 無機顔料製造業	イ 洗浄施設	○	○	○	○		○		○																	○		
	ロ ろ過施設	○	○	○	○		○		○																	○		

排出源		物質名																										
業種	施設	アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機燐 <sub>りん</sub>	Cr (Ⅵ)	As	CN	PGB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN	
26. 無機顔料製造業	ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機			○																						○		
	ホ 廃ガス洗浄施設	○	○	○	○		○		○																	○		
27. 前2号以外の無機化学工業製品製造業	イ ろ過施設	○	○	○	○		○	○	○																	○		
	ロ 遠心分離機	○	○	○	○		○	○	○																	○		
	ヘ 青酸反応施設のうち反応施設								○																	○		
	ヌ 廃ガス洗浄施設	○	○	○	○		○	○	○																	○		
	ル 湿式集じん施設	○	○	○	○		○	○	○																	○		
28. カーバイド法アセチレン誘導品製造業	イ 湿式アセチレンガス発生施設								○																			
	ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設	○	○												○													
29. コールタール製品製造業	イ ベンゼン類硫酸洗浄施設																									○		
	ロ 静置分離器																									○		
31. メタン誘導品製造業	イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち蒸留施設												○	○														
	ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設										○	○		○		○	○	○	○	○								
32. 有機顔料又は合成染料製造業	イ ろ過施設						○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○		
	ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設						○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○		
	ハ 遠心分離機						○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○		
	ニ 廃ガス洗浄施設						○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○		
33. 合成樹脂製造業	イ 縮合反応施設								○				○	○	○	○	○	○	○	○						○		○
	ロ 水洗施設								○				○	○	○	○	○	○	○	○						○		○
	ハ 遠心分離機								○				○	○	○	○	○	○	○	○						○		○
	ニ 静置分離器								○				○	○	○	○	○	○	○	○						○		○
	ホ フッ素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設										○	○		○	○	○	○	○	○	○						○		○

排 出 源		物 質 名																										
業 種	施 設	アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機リン	Cr (Ⅵ)	As	CN	PGB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN	
33. 合成樹脂製造業	リ 廃ガス洗浄施設 ヌ 湿式集じん施設								○				○	○	○	○	○		○	○					○		○	
34. 合成ゴム製造業	イ ろ過施設 ロ 脱水施設 ハ 水洗施設 ニ ラテックス濃縮施設 ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器								○		○	○	○	○	○	○	○				○				○			
35. 有機ゴム薬品製造業	イ 蒸留施設 ロ 分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設																				○	○	○					
37. 前6号以外の石油化学工業	イ 洗浄施設 ロ 分離施設 ハ ろ過施設 ニ アクリロニトリルの製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設 ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミン製造施設のうち、蒸留施設 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設 チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設			○					○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○		○







排出源	物質名																										
	アルキルHg	総Hg	Cd	Pb	有機燐 <sup>リン</sup>	Cr(Ⅵ)	As	CN	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	1,4-ジオキサン	DXN	
施設																											
※9 4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設																											○
※10 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設																											○
※11 ジオキサジンバイオレット製造施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設																											○
※12 アルミニウム又はその合金製造焙焼炉等の発生ガス処理施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																											○
※13 亜鉛回収施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																											○
※14 担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設																											○
※15 廃棄物焼却炉（火床面積が0.5m <sup>2</sup> 以上又は焼却能力が50kg/h以上のもの）の発生ガス処理施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの																											○
※16 廃PCB等又はPCB処理物分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物洗浄施設又は分離施設																											○
※17 フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設																											○

（注）業種番号と施設記号は水質汚濁防止法施行令別表第1による。

※印の業種番号と施設記号はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2による。